

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年7月20日(2006.7.20)

【公表番号】特表2002-519829(P2002-519829A)

【公表日】平成14年7月2日(2002.7.2)

【出願番号】特願2000-557480(P2000-557480)

【国際特許分類】

<i>H 01 B</i>	13/00	(2006.01)
<i>C 03 C</i>	17/245	(2006.01)
<i>C 09 C</i>	3/06	(2006.01)
<i>C 23 C</i>	14/00	(2006.01)
<i>H 01 B</i>	1/00	(2006.01)
<i>C 08 K</i>	9/02	(2006.01)

【F I】

<i>H 01 B</i>	13/00	5 0 1 Z
<i>C 03 C</i>	17/245	A
<i>C 09 C</i>	3/06	
<i>C 23 C</i>	14/00	A
<i>H 01 B</i>	1/00	D
<i>H 01 B</i>	1/00	H
<i>C 08 K</i>	9/02	

【手続補正書】

【提出日】平成18年5月25日(2006.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】(a)無機材料および高分子材料からなる群より選択される材料を各粒子がそれぞれ含んでいる、複数のコア粒子を提供する段階と、

(b)導電性金属酸化物を含む導電性被膜を、物理蒸着によって、導電性酸化物被膜が各コア粒子に接着されるように各粒子に付着させ、 E_w^* の値を有する複数の被覆粒子を含む組成物を生成する段階と、

(c)前記組成物を酸素を含む雰囲気中で任意に加熱して、前記被覆粒子の E_w^* 値を減少させる段階と、

を備える方法において、

前記被覆粒子は、体積抵抗率が約0.1cmより大きく約1000cm未満であり、

次の(I)および(II)、

(I)前記段階(b)の後の被覆粒子が E_w^* 値約50未満を有する、

(II)含まれるとすれば、前記段階(c)の後の被覆粒子が E_w^* 値約50未満を有する、

の少なくとも一方に該当する方法。

【請求項2】前記コア粒子が、ガラス、セラミック、鉱物、およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項1に記載の方法。

【請求項3】前記コア粒子は、総空隙率がセラミック橢円体の総体積の約10～約98パーセントとなるように空隙を含むセラミック橢円体、総空隙率がガラス橢円体の体

積の約 10 ~ 約 98 パーセントとなるように空隙を含むガラス構円体、およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 前記コア粒子の平均 BET 表面積が約 20 m² / グラム未満である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】 前記 (b) の被膜が酸化インジウムスズを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】 請求項 1 の方法により作製される被覆粒子。